(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-39499

(43)公開日 平成10年(1998) 2月13日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FI					技術表示箇所	
G03F	7/004	503		G 0	3 F	7/004		503	O-111 D-131 D-131	
	7/00	503				7/00		503		
	7/027	502				7/027		502		
	7/031					7/031				
	7/038					7/038				
			審查請求	未請求	請求」		OL	(全 18 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号		特願平8-194675		(71)	出願人	000001	270	-		
/99\ 山麓 m		W		ļ		コニカ株式会社				
(22)出願日		平成8年(1996)7月	東京都新宿区西新宿1丁目26番2号							
				(72)	発明者	大久保	公彦			
			1		東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会					
						社内				
				(72) §	発明者	中山	草意			
				ĺ		東京都	ヨ野市を	さくら町1番魚	也コニカ株式会	
						社内				

(54) 【発明の名称】 光開始剤、光重合組成物、ラジカル発生方法、平版印刷版作成用感光材料及び平版印刷版の作成 方法

(57)【要約】

(修正有)

【課題】 488nmまたは532nm付近の波長域で 書込が出来、解像度、感度の良好な画像を形成できる光 重合組成物、光開始剤、上記波長域の光により高感度に 発生するラジカル発生方法、上記の波長域に高い感光性 を有し、かつ保存安定性に優れた感光材料及びそれを用いた平版印刷版の作成方法の提供。

【解決手段】 ラジカル発生剤及び下記一般式(1)、(2)または(3)で表される色素を含有する光開始

一般式(1)

一般式(2)

一般式(3)

$$X = \begin{bmatrix} R_1 & 0 & R_1 & 0 \\ N & N & N & N \\ R_2 & 0 & R_2 & 0 \end{bmatrix}$$
 $L_1 - B_1 \qquad X = \begin{bmatrix} R_1 & 0 & R_1 & 0 \\ N & N & N & N \\ R_2 & 0 & R_2 & 0 \end{bmatrix}$

[式中、R1、R2は水素原子又は一価の置換基、Xは酸素原子又は硫黄原子、L1、L2、L3、L4、L5

は窒素原子またはメチン基、B1、B2、B3は5員又は6員の芳香族環残基又はヘテロ環残基を表す。〕

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ラジカル発生剤及び下記一般式(1)、

(2) または(3) で表される色素を含有することを特

一般式(3)

徴とする光開始剤。

【化1】

[式中、R1、R2は水素原子又は一価の置換基を表し、Xは酸素原子又は硫黄原子を表し、L1、L2、L3、L4、L5は窒素原子またはメチン基を表し、B1、B2、B3は5員又は6員の芳香族環残基又はヘテロ環残基を表す。〕

【請求項2】 重合促進剤としてアミン化合物又はイオウ化合物を含有することを特徴とする請求項1に記載の光開始剤。

【請求項3】 エチレン性不飽和結合を有する化合物及び請求項1又は2に記載の光開始剤を含有することを特徴とする光重合組成物。

【請求項4】 ラジカル発生剤が有機過酸化物、オニウム塩、ハロゲン化トリアジン、鉄アレーン錯体、ビスイミダゾール、チタノセン化合物又は有機過酸化物体から選ばれる少なくとも一種の化合物であることを特徴とする請求項1又は2に記載の光開始剤。

【請求項5】 ラジカル発生剤が有機過酸化物、オニウム塩、ハロゲン化トリアジン、鉄アレーン錯体、ビスイミダゾール、チタノセン化合物又は有機過酸化物体から選ばれる少なくとも一種の化合物であることを特徴とする請求項3に記載の光重合組成物。

【請求項6】 チタノセン化合物及び前記一般式(2) または一般式(3)で表される色素を含有することを特徴とする光開始剤。

【請求項7】 チタノセン化合物及び前記一般式(2) または一般式(3)で表される色素を含有することを特 徴とする光重合組成物。

【請求項8】 請求項 $1\sim4$ の何れか1項に記載の光開始剤を488nmまたは532nmの波長のレーザー光で露光することを特徴とするラジカル発生方法。

【請求項9】 親水性支持体上に少なくとも感光性層及び保護層とをこの順に設けてなる平版印刷版作成用感光材料において、該感光性層はエチレン性不飽和結合を少なくとも1つ有する化合物、バインダー成分、請求項3、5又は7に記載の光重合組成物を含有していることを特徴とする平版印刷版作成用感光材料。

【請求項10】 親水性支持体上に少なくとも感光性層及び保護層とをこの順に設けてなる平版印刷版作成用感光材料において、該感光性層はエチレン性不飽和結合を少なくとも1つ有する化合物、バインダー成分、請求項3、5又は7に記載の光重合組成物を含有していること

を特徴とする平版印刷版作成用感光材料を用いる平版印刷版の作成方法において、該感光層に488nm又は532nmの波長のレーザー光で像様に走査露光を行なった後、保護層及び感光性層の未露光部を溶出除去することを特徴とする平版印刷版の作成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は新規な増感色素とラジカル発生剤を用いた光開始剤、光重合組成物、ラジカル発生方法、平版印刷版作成用感光材料および平版印刷版の作成方法、に関し、更に詳しくは、増感色素としてバルビツール酸又はチオバルビツール酸系のメチン、アゾメチンおよびジメチン増感色素とラジカル発生剤を用いた光開始剤、ラジカル重合可能なエチレンと性不飽和結合を有する化合物を可視光線の露光により短時間に重合させ、例えば、インキ、感光性印刷版、フォトレジスト、ダイレクト刷版材料、製版用プルーフ材料、ホログラム材料、封止剤、接着剤、光造形材料等の分野において、良好な物性を持った硬化物を得るための光重合組成物、ラジカル発生方法、平版印刷版作成用感光材料および平版印刷版の作成方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体レーザ、YAGレーザは、安定性、小型、メンテナンスの容易性などの点から、画像記録用としてレーザとして用いられることが多くなってきている。これらのレーザは低波長化がすすんでおり、特に、YAG(1064nm)のSHGを用いたレーザ(532nm)などが実用化されている。

【0003】半導体レーザやYAGレーザなどのレーザを用いて像様露光を行うことでラジカル重合させて露光部を硬化し、未露光部との物性を変化させて現像により画像形成する方法が知られている。

【0004】画像形成を行うためにはレーザ光源の波長に適した感材を選択する必要があり、ラジカル重合の開始剤として、ラジカル発生剤は数多く研究されている. が、いずれも、単独では紫外部にしか吸収をもたないものが多く、通常は光源の波長にあわせた増感色素を組み合わせて用いる。

【0005】488mmのアルゴンレーザや532mmのW-YAGレーザの光源に対応した増感色素とラジカル発生剤の組み合わせ(以下開始剤系)も、さまざまな

ものが知られている。

【0006】たとえば、米国特許第2,850,445号にはある種の光還元性染料が効果的な増感色素として記載されている。また、特公昭44-20189号には染料とアミンの複合開始系、特公昭45-37377号にはビイミダゾールとラジカル発生剤および染料の系、特公昭47-2528号、特開昭54-155292号にはビイミダゾールとジアルキルアミノベンジリデンケトンの系、特開昭58-15503号にはケト置換クマリン化合物と活性ハロゲン化物の系、特開昭54-15102号には置換トリアジンとメロシアニン色素の系が提案されているが、いずれも、感度が低く、保存性が悪いなどの問題があった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は従来技術の問題点を改良すべく為されたものである。即ち、本発明の第1の目的は、488nmまたは532nm付近で書込が出来、解像度、感度の良好な画像を形成できる光重合組成物を提供することにある。本発明の第2の目的は、保存性の良好な光重合組成物の提供にある。本発明の第3の目的は、488nmまたは532nm付近の光により高感度にラジカルを発生するラジカル発生方法の提供にある。第4の目的は488nmまたは532nm付近

の波長域に高い感光性を有し、かつ保存安定性に優れた 平版印刷版作成用の感光材料及びそれを用いた平版印刷 版の作成方法を提供することにある。第5の目的は高感 度の光開始剤を提供することにある。

[8000]

【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意検討の結果、特定のバルビツール酸又はチオバルビツール酸メチン系、バルビツール酸又はチオバルビツール酸アゾ系、バルビツール酸又はチオバルビツール酸アゾメチン系並びにバルビツール酸又はチオバルビツール酸ジメチン系色素を従来用いられているラジカル発生剤と組み合わせた488nmまたは532nmの可視光を吸収しラジカル発生能を有する開始剤系が、高感度でかつ保存性すぐれるという予期せざる結果を見い出し本発明を完成するに至った。

【0009】本発明の上記目的は以下の構成により達成される。

【0010】1.ラジカル発生剤及び下記一般式

(1)、(2)または(3)で表される色素を含有する ことを特徴とする光開始剤。

【0011】 【化2】

一般式(1) 一般式(2)

一般式(3)

【0012】式中、R1、R2は水素原子又は一価の置換基を表し、Xは酸素原子又は硫黄原子を表し、L1、L2、L3、L4、L5は窒素原子またはメチン基を表し、B1、B2、B3は5員又は6員の芳香族環残基又はヘテロ環残基を表す。

【0013】2. 重合促進剤としてアミン化合物又はイオウ化合物を含有することを特徴とする前記1に記載の光開始剤。

【0014】3. エチレン性不飽和結合を有する化合物及び前記1又は2に記載の光開始剤を含有することを特徴とする光重合組成物。

【0015】4. ラジカル発生剤が有機過酸化物、オニウム塩、ハロゲン化トリアジン、鉄アレーン錯体、ビスイミダゾール、チタノセン化合物又は有機過酸化物体から選ばれる少なくとも一種の化合物であることを特徴とする前記1又は2に記載の光開始剤。

【0016】5. ラジカル発生剤が有機過酸化物、オニウム塩、ハロゲン化トリアジン、鉄アレーン錯体、ビスイミダゾール、チタノセン化合物又は有機過酸化物体から選ばれる少なくとも一種の化合物であることを特徴とする前記3に記載の光重合組成物。

【0017】6. チタノセン化合物及び前記一般式

(2)または一般式(3)で表される色素を含有するこ とを特徴とする光開始剤。

【0018】7. チタノセン化合物及び前記一般式

(2) または一般式(3) で表される色素を含有することを特徴とする光重合組成物。

【0019】8.前記1~4の何れか1項に記載の光開 始剤を488mmまたは532mmの波長のレーザー光 で露光することを特徴とするラジカル発生方法 。

【0020】9. 親水性支持体上に少なくとも感光性層及び保護層とをこの順に設けてなる平版印刷版作成用感光材料において、該感光性層はエチレン性不飽和結合を少なくとも1つ有する化合物、バインダー成分、前記3、5又は7に記載の光重合組成物を含有していることを特徴とする平版印刷版作成用感光材料。

【0021】10. 親水性支持体上に少なくとも感光性層及び保護層とをこの順に設けてなる平版印刷版作成用感光材料であり、該感光性層はエチレン性不飽和結合を少なくとも1つ有する化合物、バインダー成分、前記3、5又は7に記載の光重合組成物を含有していることを特徴とする平版印刷版作成用感光性材料を用いる平版

印刷版の作成方法において、該感光層に488nm又は532nmの波長のレーザー光で像様に走査露光を行なった後、保護層及び感光性層の未露光部を溶出除去することを特徴とする平版印刷版の作成方法。

【0022】以下、本発明を更に詳細に述べる。

【0023】まず、前記一般式(1)、(2)及び

(3) で表される増感色素について詳述する。

一般式(4)

B1.B3

$$B^{2} \xrightarrow[N]{R_{18}} (R_{17})_{p} \xrightarrow[N]{R_{18}} (R_{17})_{p}$$

【0026】一般式(4)において、 R_{17} は各々水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、-O R_{18} 、 $-SR_{18}$ 、 $-NR_{19}$ R_{20} を表し、 R_{18} 、 R_{19} 、 R_{20} は水素原子、アルキル基、又はアリール基を表し、Y は酸素原子又は硫黄原子を表し、Pは0~4の整数を表し、Qは0~3の整数を表し、 R_{20} になるの整数を表す。 R_{20} の変数を表す。 R_{20} の変数を表す。 R_{20} になるの変数を表す。 $R_{$

【0027】一般式 (1)、 (2)、 (3) 及び (4) における R_1 、 R_2 、 R_{17} 、 R_{18} 、 R_{19} 、 R_{20} で表される アルキル基としては、炭素数 $1\sim12$ の鎖状又は環状の アルキル基 (例えば、メチル、エチル、ベンジル、フェネチル、プロピル、ブチル、イソブチル、ペンチル、ヘキシル、オクチル、ノニル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシル等の各基)が好ましく、置換基を有していてもよい。

【0028】 R_1 、 R_2 、 R_{17} 、 R_{18} 、 R_{19} 、 R_{20} で表されるアリール基は、炭素数 $6\sim12$ のアリール基(例えば、フェニル、ナフチル)が好ましく、置換基を有していてもよい。

【0029】R1、R2で表される複素環残基は、5又は

【0024】一般式(1)、(2)及び(3)中の B₁、B₂およびB₃は5員、6員の2価の芳香族環残基 又はヘテロ環残基を表し、具体的には下記一般式(4) で表される。

[0025]

【化3】

6員の複素環残基(例えば、オキサゾリル環、ベンゾオキサゾール環、チアゾール環、イミダゾール環、ピリジン環、フラン環、チオフエン環、スルホラン環、ビラゾール環、ピロール環、クロマン環、クマリン環等の残基)が好ましく、置換基を有していてもよい。

【0030】 R_1 、 R_2 で表されるアルケニル基は、炭素数 $2\sim12$ のアルケニル基(例えば、ビニル、アリル、1-プロペニル、2-ペンテニル、1, 3-ブタジエニル等の各基)が好ましい。

【0031】 L_1 、 L_2 、 L_3 、 L_4 、 L_5 は窒素原子またはメチン基を表し、該メチン基は、無置換でも置換していても良い。

【0032】上記した各基が有していてもよい置換基は、例えば、カルボン酸基、炭素数1~12のスルホンアミド基(例えば、メタンスルホンアミド、ベンゼンスルホンアミド、ブタンスルホンアミド、nーオクタンスルホンアミド等の各基)、炭素数0~12のスルファモイル基(例えば、無置換のスルファモイル、メチルスルファモイル、フェニルスルファモイル、ブチルスルファモイル、同えば、メタンスルホニルカルバモイルよ(例えば、メタンスルホニルカルバモイル、プロパンスルホニルカルバモイル、ベンゼンスルホニルカ

ルバモイル等の各基)、炭素数1~12のアシルスルフ ァモイル基(例えば、アセチルスルファモイル、プロピ オニルスルファモイル、ピバロイルスルファモイル、ベ ンゾイルスルファモイル等の各基)、炭素数1~12の 鎖状又は環状のアルキル基(例えば、メチル、エチル、 イソプロピル、ブチル、ヘキシル、シクロプロピル、シ クロペンチル、シクロヘキシル、2-ヒドロキシエチ ル、4-カルボキシブチル、2-メトキシエチル、ベン ジル、フェネチル、4-カルボキシベンジル、2-ジエ チルアミノエチル等の各基)、炭素数2~12のアルケ ニル (例えば、ビニル、アクリル等の各基) 、炭素数1 ~12のアルコキシ基(例えば、メトキシ、エトキシ、 ブトキシ等の各基)、ハロゲン原子(例えば、F、C 1、Br等の各原子)、炭素数0~12のアミノ基(例 えば、無置換のアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミ ノ、カルボキシエチルアミノ等の各基)、炭素数2~1 2のエステル基 (例えば、メトキシカルボニル基) 、炭 素数1~12のアミド基(例えば、アセチルアミノ、ペ ンズアミド等の各基)、炭素数1~12のカルバモイル 基(例えば、無置換のカルバモイル、メチルカルバモイ ル、エチルカルバモイル等の各基)、炭素数6~12の アリール基(例えば、フェニル、ナフチル、4-カルボ キシフェニル、3-カルボキシフェニル、3,5-ジカ

ルボキシフェニル、4-メタンスルホンアミドフェニ ル、4-ブタンスルホンアミドフェニル等の各基)、炭 素数6~10のアリールオキシ基(例えば、フェノキ シ、4-カルボキシフェノキシ、4-メチルフェノキ シ、ナフトキシ等の各基)、炭素数1~8のアルキルチ オ基 (例えば、メチルチオ、エチルチオ、オクチルチオ 等の各基)、炭素数6~10のアリールチオ基(例え ば、フェニルチオ、ナフチルチオ等の各基)、炭素数1 ~10のアシル基(例えば、アセチル、ベンゾイル、プ ロパノイル等の各基)、炭素数1~10のスルホニル基 (例えば、メタンスルホニル、ベンゼンスルホニル等の 各基)、炭素数1~10のウレイド基(例えば、ウレイ ド、メチルウレイド等の各基)、炭素数2~10のウレ タン基 (例えば、メトキシカルボニルアミノ、エトキシ カルボニルアミノ等の各基)、シアノ基、水酸基、ニト ロ基、複素環残基(例えば、5-カルボキシベンゾオキ サゾール環、ピリジン環、スルホラン環、フラン環、ピ ロール環、ピロリジン環、モルホリン環、ピペラジン 環、ピリミジン環等の残基)等を挙げることができる。 【0033】次に本発明の増感色素の化合物例を挙げ

[0034]

【化4】

D-5
$$C_2H_5$$
 C_3H_7 C_3H_7

[0035]

D-11

$$O = CH - CH_3$$
 $O = CH_3$
 $O = C$

[0036]

D-21
$$C_{2}H_{5}OC-H_{2}C$$

$$S=\begin{pmatrix} O & C_{2}H_{5} & C_{2}H_$$

【0037】本発明の増感色素は従来公知の方法により 準じて合成できるが以下に合成例を挙げる。

【0038】合成例1(例示色素D-5の合成)

【0039】 【化7】

【0040】エタノール30m1中にN, N' ージエチルバルビツール酸1.84g(化合物(1))とN, N' ージメチルチオフェンアルデヒド(化合物(2))1.71gを入れ、加熱還流下1時間撹拌した。析出物を濾取し、エタノール-アセトンで洗浄し、乾燥して例

示色素D-5を2. 18gを得た。nmr、massスペクトルにより目的物であることを確認した。

【0041】合成例2(例示色素D-22の合成) 【0042】

【化8】

(合成ルート)

(合成ルート)

$$C_2H_5O$$
 S
 C_2H_5O
 C_2H_5O

D-22

【0043】 100m1 ナスフラスコ中に2-メチルー 5-エトキシベンズチアゾール 20g とトシル酸 n-プロピルをいれ 150 $\mathbb C$ で1時間加熱撹拌した。一晩放置して放冷後、アセトンを加えて結析し、化合物(3)を 40g 得た。化合物(3) 40g とジフェニルホルムアミジン 22g を 200m1 のナスフラスコに入れ、130 $\mathbb C$ で 10 分間加熱撹拌した。次に無水酢酸 60m1 を 加え、さらに 10 分間加熱撹拌した。放冷後、イソプロピルエーテル中に反応液を加えて、生じた沈殿を濾取して化合物(4)を 16g 得た。

5

【0044】100mlナスフラスコ中に化合物(4) 6.0g、N-ノルマルブチル-N-(3-メトキシ) エチルバルビツール酸(化合物(5))3.1g、ピリジン20ml、トリエチルアミン1mlを加えて加熱撹拌し、次に無水酢酸3mlを加えた。100℃で30分間加熱撹拌した後、反応液を1規定塩酸水溶液100mlに加え、酢酸エチル80mlで抽出した。この酢酸エチル相を10%重曹水溶液で洗浄した後、減圧濃縮し、生じた沈殿を濾取した。アセトニトリルから再結晶し、3.0gの例示色素D-22を得た。nmr、massスペクトルにより目的物であることを確認した。

【0045】次にラジカル発生剤について説明する。 【0046】ラジカル発生剤として、好ましくはハロゲ

【0046】ラジカル発生剤として、好ましくはハロケン化物(α-ハロアセトフェノン類、トリクロロメチル

トリアジン類等)、アゾ化合物、芳香族カルボニル化合物(ベンゾインエステル類、ケタール類、アセトフェノン類、o-アシルオキシイミノケトン類、アシルホスフィンオキサイド類等)、ヘキサアリールビスイミダゾール化合物、過酸化物、鉄アレーン錯体、チタノセン化合物などが挙げられる。

【0047】過酸化物としては、特開昭59-1504 号ならびに特開昭61-240807号記載の有機過酸 化物を用いることができる。

【0048】具体的な化合物としては、メチルエチルケ トンパーオキサイド、メチルイソブチルケトンパーオキ サイド、シクロヘキサノンパーオキサイド、メチルシク ロヘキサノンパーオキサイド、メチルシクロヘキサノン パーオキサイド、3,3,5-トリメチルシクロヘキサ ノンパーオキサイドなどのケトンパーオキサイド、アセ チルパーオキサイド、プロピオニルパーオキサイド、イ ソブチルパーオキサイド、オクタノイルパーオキサイ ド、3,5,5-トリメチルヘキサノイル、デカノイル パーオキサイド、ウラロイルパーオキサイド、ベンゾイ ルパーキサイド、ベンゾイルパーオキサイド、p-クロ ロベンゾイルパーオキサイド、2,4-ジクロロベンゾ イルパーオキサイド、アセチルシクロヘキサンスルホニ ルパーオキサイドなどのジアシルパーオキサイド類、 t ertーブチルヒドロパーオキサイド、クメンヒドロパ ーオキサイド、ジイソプロピルベンゼンヒドロパーオキ サイド、p-メタンヒドロパーオキサイド、2,5-ジ メチルヘキサン-2,5-ジヒドロパーオキサイド、 1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルヒドロパーオキサ イドなどのヒドロパーオキサイド類、ジーtert-ブ チルパーオキサイド、tert-ブチルクミルパーオキ

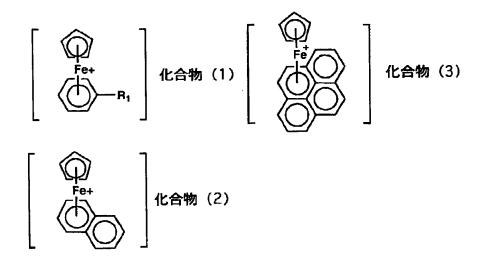
サイド、1,3-ビス(tert-ブチルパーオキシイ ソプロピル)ベンゼン、2、5-ジメチルー2、5-ジ (tert-ブチルパーオキシ-3, 3, 5-トリメチ ルシクロヘキサン、n-ブチル-4, 4' -ビス(te r t - ブチルパーオキシ) ブタンなどのパーオキシケタ ール類、tert-ブチルパーオキシアセテート、te rtーブチルパーオキシイソブチレート、tertーブ チルパーオキシオクトエート、tert-ブチルパーオ キシピバレート、tert-ブチルパーオキシネオデカ ネート、tert-ブチルパーオキシ-3,5,5-ト リメチルヘキサノエート、tert-ブチルパーオキシ ベンゾエートジー tertーブチルパーオキシフタレー ト、tert-ブチルパーオキシイソフタレート、te r t - ブチルパーオキシラウレート、2, 5 - ジメチル -2.5-ジベンゾイルパーオキシヘキサンなどのアル キルパーエステル類、ジー2-エチルヘキシルパーオキ シジカーボネート、ジーイソプロピルパーオキシジカー ボネート、ジー s e c ーブチルパーオキシカーボネー ト、ジ-n-プロピルパーオキシジカーボネート、ジー メトキシイソプロピルパーオキシジカーボネート、ジ-3-メトキシブチルパーオキシジカーボネート、ジ-2 ーエトキシエチルパーオキシジカーボネート、ビスー (4-tert-ブチルシクロヘキシル) パーオキシジ カーボネートなどのパーオキシカーボネート類、コハク 酸パーオキシキサイドに代表される水溶性パーオキサイ ド類が挙げられる。

【0049】好ましくは、特に、下記の構造の有機過酸化物を用いることができる。

【0050】 【化9】

【 O O 5 1】 本発明で好ましく用いることができる鉄アレーン錯体としては下記の構造のものがあげられる。

【0052】 【化10】



化合物(4)

を用いる。

【0053】本発明で好ましく用いることができるチタ ノセン化合物としては、特に限定されないが、例えば特 開昭59-152396号、特開昭61-151197 号各公報等に記載されている各種チタノセン化合物から 適宜選んで用いることができる。さらに具体的には、ジ シクロペンタジエニルーT i - ジクロライド、ジシクロ ペンタジエニルーTi-ビス-フェニル、ジシクロペン タジエニル-Ti-ビス-2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニー1ーイル、ジシクロペンタジエニルー Ti-ビス-2, 3, 5, 6-テトラフルオロフェニー 1-イル、ジシクロペンタジエニル-Ti-ビス-2, 4, 6-トリフルオロフェニー1-イル、ジシクロペン タジエニルーTi-ビス-2,6-ジフルオロフェニー 1-イル、ジシクロペンタジエニル-Ti-ビス-2, 4-ジフルオロフェニ-1-イル、ジメチルペンタジエ $= \mu - T_{i} - \forall z - 2, 3, 4, 5, 6 - ペンタフルオ$ ロフェニ-1-イル、ジメチルペンタジエニル-Ti-ビス-2、3、5、6-テトラフルオロフェニ-1-イ ル、ジメチルペンタジエニル-Ti-ビス-2,6-ジ フルオロフェニー1ーイル、ジシクロペンタジエニルー Ti - UZ - 2, 6 - UZ - 3 - UZ - 1 - 1ル) -フェニ-1-イル(以下、Ti-1という) これらの中で、特に好ましいものは、下記の構造である Ti-1 である。

[0054] 【化11】

Ti-1

【0055】本発明では以下のオニウム塩を好ましく用 いることができる。

【0056】オニウム塩としては、ヨードニウム塩、ス ルフォニウム塩、ホスフォニウム塩、スタンノニウム塩 などがあげられる。

【0057】特公昭55-39162号、特開昭59-14023号及び「マクロモレキュルス(Macrom olecules)、第10巻、第1307頁(197 7年) 記載の各種オニウム化合物を用いることができ る。ヨードニウム塩としては、好ましくは、ジアリール ョードニウム塩を用いることもできる。

【0058】また、オニウム塩としては、ジフェニルヨ ードニウム塩、ジトリルヨードニウム塩、フェニル(p -メトキシフェニル) ヨードニウム塩、ビス (m-ニト ロフェニル) ヨードニウム塩、ビス (p-tert-ブ チルフェニル) ヨードニウム塩、ビス (p-シアノフェ ニル) ヨードニウム塩等のクロリド、ブロミド、四フッ 化ホウ素塩、六フッ化ホウ素塩、六フッ化リン塩、六フ

ッ化ヒ素塩、六フッ化アントモン塩、過塩素酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、pートルエンスルホン酸塩、pートリフルオロメチルベンゼンスルホン酸塩、nーブチルトリフェニルホウ素塩等も挙げられる。

【0059】本発明では2,4,5-トリアリールイミ ダゾール2量体を好ましく用いることができる。

【0060】特開昭55-127550号、特開昭60-202437号に記載されている下記の構造のものを用いることが好ましい。

[0061]

【化12】

【0062】本発明のラジカル発生剤の添加量は、ラジカル発生剤の種類及び使用形態により異なるが、エチレン性不飽和結合を少なくとも1つ有する化合物100重量部に対して0.01~10重量部が好ましい。

【0063】支持体としては、紙、合成紙(たとえばポリプロピレンを主成分とする合成紙)、樹脂のフィルムあるいはシート、さらには樹脂を2層以上積層してなるプラスチックフィルムまたはシート、あるいは各種高分子材料、金属、セラミックもしくは木材パルプやセルロースパルプ、サルファイトパルプなどで抄造された紙等に、樹脂層を積層したフィルムまたはシートなどを挙げることができる。

【0064】このような樹脂のフィルムあるいはシートを構成する樹脂としては、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル等のアクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリアリレート等等のポリエステル系樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリフッ化ビニリデン、ポリエチレン、樹脂、ポリアミド等のポリアミド系樹脂、ポリエーテルケトン、ポリエーテルイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルがシスルホン、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーカー・ボリスに、オリイミが出版、フェノキシ樹脂、フェノール樹脂、フェノール樹脂、フェノール樹脂、シリコーン樹脂などが挙げられる。

【 O O 6 5 】本発明を平版印刷版作成用として用いる場合の感光性層を設ける支持体としては、アルミニウム、亜鉛、銅、鋼等の金属板、並びにクロム、亜鉛、銅、ニッケル、アルミニウム、鉄等がメッキまたは蒸着された金属板、紙、プラスチックフィルム及びガラス板、樹脂が塗布された紙、アルミニウム等の金属箔が張られた紙、親水化処理したプラスチックフィルム等が挙げられ

る。これらの内好ましいのは、アルミニウム板である。本発明の支持体としては、砂目立て処理、陽極酸化処理及び必要に応じて封孔処理等の表面処理が施されたアルミニウム板を用いることがより好ましい。これらの処理には公知の方法を用いることができる。砂目立て処理の方法としては、例えば、機械的方法、電解によりエッチングする方法が挙げられる。機械的方法としては、例えば、ボール研磨法、ブラシ研磨法、液体ホーニングによる研磨法、バフ研磨法が挙げられる。アルミニウム材の組成等に応じて上述の各種方法を単独あるいは組合せて用いることができる。好ましいのは、電解エッチングによる方法である。

【0066】電解エッチングは、燐酸、硫酸、塩酸、硝酸等の酸の単独ないし2種以上混合した浴で行われる。砂目立て処理の後、必要に応じてアルカリあるいは酸の水溶液によってデスマット処理を行い中和して水洗する。

【0067】陽極酸化処理には、電解液として、硫酸、クロム酸、シュウ酸、燐酸、マロン酸等を1種又は2種以上含む溶液を用いアルミニウム板を陽極として電解して行われる。形成された陽極酸化皮膜量は1~50mg/dm²が適当であり、好ましくは10~40mg/dm²である。陽極酸化皮膜量は、例えば、アルミニウム板を燐酸クロム酸溶液に浸積し、酸化皮膜を溶解し、板の皮膜溶解前後の重量変化測定等から求められる。

【0068】封孔処理は、沸騰水処理、水蒸気処理、ケイ酸ソーダ処理、重クロム酸塩水溶液処理などが具体例として挙げられる。この他にアルミニウム板支持体に対して、水溶性高分子化合物や、フッ化ジルコン等の金属塩水溶液による下引処理を施すこともできる。

【0069】支持体の厚さは通常 $3\sim1000\mu$ mがよく、 $8\sim300\mu$ mがより好ましい。

【0070】感光層に用いられるバインダー樹脂として は、公知の種々のポリマーを使用することができる。具 体的なバインダーの詳細は、米国特許4,072,52 7号に記載されており、より好ましくは特開昭54-9 8613号公報に記載されているような芳香族性水酸基 をを有する単量体、例えばN- (4-ヒドロキシフェニ ル) アクリルアミド、N- (4-ヒドロキシフェニル) メタクリルアミド、oー、mー、又はpーヒドロキシス チレン、o-、m-、又はp-ヒドロキシフェニルメタ クリレート等と他の単量体との共重合物、米国特許第 4,123,276号明細書中に記載されているような ヒドロキシエチルアクリレート単位又はヒドロキシエチ ルメタクリレートを含むポリマー、シェラック、ロジン 等の天然樹脂、ポリビニルアルコール、米国特許第3, 751,257号明細書中に記載されているようなポリ アミド樹脂、米国特許第3,660,097号明細書中 に記載されているような線状ポリウレタン樹脂、ポリビ ニルアルコールのフタレー化樹脂、ビスフェノールAと

エピクロルヒドリンから縮合されたエポキシ樹脂、酢酸 セルロース、セルロースアセテートフタレート等のセル ロース樹脂が挙げられる。

【0071】バインダー樹脂としては前述の樹脂の中から、1種または2種以上のものを組み合わせて用いることができる。

【0072】中でも塩化ビニル、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合樹脂、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリビニルブチラール、スチレンーアクリロニトリル、ポリビニルアセタール、ニトロセルロース、エチルセルロース等の溶剤可溶性ポリマーが好ましい。

【0073】これらのバインダーは、1種又は2種以上を有機溶媒に溶解して用いるだけでなく、ラテックス分散の形で使用してもよい。バインダーの使用量としては、本発明の画像形成材料の目的に応じて、又、単層構成であるか重層構成であるかにより異なるが、支持体 $1m^2$ 当たり $1.0\sim20g$ が好ましい。

【0074】次にエチレン性不飽和結合を有する化合物 について詳述する。

【0075】本発明のエチレン性不飽和二重結合を有する化合物とは、光重合性組成物が活性光線の照射を受けた場合、光開始剤の作用により付加重合し、硬化するようなエチレン性不飽和二重結合であって、例えば該エチレン性不飽和二重結合を有する重合体である。尚、本発明における単量体の意味するところは、所謂高分子物質に相対する概念であって、従って、狭義の単量体以外に二量体、三量体、オリゴマーをも包含するものである。

【0076】重合可能な化合物としては公知のモノマー が特に制限なく使用することができる。具体的モノマー としては、例えば、2-エチルヘキシルアクリレート、 2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシプ ロピルアクリレート等の単官能アクリル酸エステルおよ びその誘導体あるいはこれらのアクリレートをメタクリ レート、イタコネート、クロトネート、マレエート等に 代えた化合物、ポリエチレングリコールジアクリレー ト、ペンタエリスリトールジアクリレート、ビスフェノ ールAジアクリレート、ヒドロキシピバリン酸ネオペン チルグリコールのεーカプロラクトン付加物のジアクリ レート等の2官能アクリル酸エステルおよびその誘導体 あるいはこれらのアクリレートをメタクリレート、イタ コネート、クロトネート、マレエート等に代えた化合 物、あるいはトリメチロールプロパントリ(メタ)アク リレート、ジペンタエリスリトールペンタアクリレー ト、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ピロ ガロールトリアクリレート等の多官能アクリル酸エステ ルおよびその誘導体あるいはこれらのアクリレートをメ

タクリレート、イタコネート、クロトネート、マレエー ト等に代えた化合物等を挙げることができる。

【0077】また適当な分子量のオリゴマーにアクリル酸、またはメタアクリル酸を導入し、光重合性を付与した、いわゆるプレポリマーと呼ばれるものも好適に使用できる。

【0078】この他に特開昭58-212994号、同61-6649号、同62-46688号、同62-48589号、同62-173295号、同62-187092号、同63-67189号、特開平1-244891号公報等に記載の化合物などを挙げることができ、さらに「11290の化学商品」化学工業日報社、p.286~p.294に記載の化合物、「UV・EB硬化ハンドブック(原料編)」高分子刊行会、p.11~65に記載の化合物なども本発明においては好適に用いることができる。

【0079】これらの中で、分子内に2個以上のアクリル基またはメタクリル基を有する化合物が本発明においては好ましく、さらに分子量が10,000以下、より好ましくは5,000以下のものが好ましい。また本発明ではこれらのモノマーあるいはプレポリマーのうち1種または2種以上を混合して用いることができる。

【0080】上記エチレン性不飽和基を有する化合物は本発明において感光層中に好ましくは20~80重量部、より好ましくは30~70重量部含有される。

【0081】本発明の感光性層には目的を損なわない範囲であれば、増感剤、重合促進剤、熱重合禁止剤、熱溶融性化合物、酸素補足剤、可塑剤等の他の成分を含有せしめることは任意である。

【0082】増感剤としては特開昭64-13140号に記載のトリアジン系化合物、特開昭64-13141号に記載の芳香族オニウム塩、芳香族ハロニウム塩、特開昭64-13143号に記載の有機過酸化物、特公昭45-37377号明や米国特許第3,652,275号に記載のビスイミダゾール化合物、チオール類等が挙げられる。増感剤の添加量は、エチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物とバインダーの合計量100重量部に対して、10重量部以下、好ましくは0.01~5重量部程度添加される。

【0083】重合促進剤としては、アミン化合物やイオウ化合物(チオール、ジスルフィド等)に代表される重合促進剤や連鎖移動触媒等を添加することが可能である。

【0084】本発明の光重合性組成物に添加可能な重合促進剤や連鎖移動触媒の具体例としては、例えば、N-フェニルグリシン、トリエタノールアミン、N、N-ジエチルアニリン等のアミン類、米国特許第4,414,312号や特開昭64-13144号記載のチオール類、特開平2-29161号記載のジスルフィド類、米国特許第3、558、322号や特開昭64-1704

8号記載のチオン類、特開平2-21560号記載のo-アシルチオヒドロキサメートやN-アルコキシピリジンチオン類があげられる。特に好ましくはアミン化合物としてはN、N-ジエチルアニリンであり、イオウ化合物としては2-メルカプトベンゾチアゾールである。

【0085】熱重合防止剤としては、キノン系、フェノール系等の化合物が好ましく用いられる。例えば、ハイドロキノン、ピロガロール、p-メトキシフェノール、カテコール、 $\beta-$ ナフトール、2, 6-ジー t-ブチルーp-クレゾール等が挙げられる。エチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物とバインダーの合計量100重量部に対して、10重量部以下、好ましくは0.01~5重量部程度添加される。

【0086】酸素クエンチャーとしてはN, Nジアルキルアニリン誘導体が好ましく、例えば米国特許4,772,541号の第11カラム58行目から第12カラム35行目に記載の化合物が挙げられる。

【0087】可塑剤としては、フタル酸エステル類、トリメリット酸エステル類、アジピン酸エステル類、その他飽和あるいは不飽和カルボン酸エステル類、クエン酸エステル類、エポキシ化大豆油、エポキシ化アマニ油、エポキシステアリン酸エポキシ類、正リン酸エステル類、亜燐酸エステル類、グリコールエステル類などが挙げられる。

【0088】熱溶融性化合物としては、常温で固体であ り、加熱時に可逆的に液体となる化合物が用いられる。 前記熱溶融性物質としては、テルピネオール、メントー ル、1,4-シクロヘキサンジオール、フェノール等の アルコール類、アセトアミド、ベンズアミド等のアミド 類、クマリン、ケイ皮酸ベンジル等のエステル類、ジフ ェニルエーテル、クラウンエーテル等のエーテル類、カ ンファー、p-メチルアセトフェノン等のケトン類、バ ニリン、ジメトキシベンズアルデヒド等のアルデヒド 類、ノルボルネン、スチルベン等の炭化水素類、マルガ リン酸等の高級脂肪酸、エイコサノール等の高級アルコ ール、パルミチン酸セチル等の高級脂肪酸エステル、ス テアリン酸アミド等の高級脂肪酸アミド、ベヘニルアミ ン等の高級アミンなどに代表される単分子化合物、蜜ロ ウ、キャンデリラワックス、パラフィンワックス、エス テルワックス、モンタンロウ、カルナバワックス、アミ ドワックス、ポリエチレンワックス、マイクロクリスタ リンワックスなどのワックス類、エステルガム、ロジン マレイン酸樹脂、ロジンフェノール樹脂等のロジン誘導 体、フェノール樹脂、ケトン樹脂、エポキシ樹脂、ジア リルフタレート樹脂、テルペン系炭化水素樹脂、シクロ ペンタジエン樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポリカプロ ラクトン系樹脂、ポリエチレングリコール、ポリプロピ レングリコールなどのポリオレフィンオキサイドなどに 代表される高分子化合物などを挙げることができる。

【0089】更に必要に応じて感光性層に酸化防止剤、

フィラー、帯電防止剤などを添加しても良い。前記酸化防止剤としては、クロマン系化合物、クラマン系化合物、フェノール系化合物、ハイドロキノン誘導体、ヒンダードアミン誘導体、スピロインダン系化合物、硫黄系化合物、リン系化合物などが挙げられ、特開昭59-182785号、同60-130735号、同61-159644号、特開平1-127387号、「11290の化学商品」化学工業日報社、p.862~868等に記載の化合物、および写真その他の画像記録材料に耐久性を改善するものとして公知の化合物を挙げることができる。

【0090】フィラーとしては、無機微粒子や有機樹脂粒子を挙げることができる。この無機微粒子としてはシリカゲル、炭酸カルシウム、酸化チタン、酸化亜鉛、硫酸バリウム、タルク、クレー、カオリン、酸性白土、活性白土、アルミナ等を挙げることができ、有機樹脂粒子としてはフッ素樹脂粒子、グアナミン樹脂粒子、アクリル樹脂粒子、シリコン樹脂粒子等の樹脂粒子、帯電防止剤としては、カチオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、非イオン性界面活性剤、高分子帯電防止剤、導電性微粒子などのほか「11290の化学商品」化学工業日報社、p.875~p.876などに記載の化合物なども好適に用いることができる。

【0091】本発明において、感光性層は単層で形成されても良いし、二層以上の複数層で構成されても良い。また複数層で構成する場合は組成の異なる感光性層で構成してもよく、この場合は着色剤を含有しない感光性層を含んでいてもよい。

【0092】本発明において、感光性層の厚みは0.2 $\sim 10 \mu$ mが好ましく、より好ましくは $0.5 \sim 5 \mu$ m である。

【0093】感光性層は形成成分を溶媒に分散あるいは溶解して塗工液を調製し、この塗工液を前記中間層上に直接積層塗布し乾燥するか又は後述するカバーシート上に塗布し乾燥して形成される。

【0094】上記塗工法に用いる溶媒としては、水、アルコール類(例えばエタノール、プロパノール)、セロソルブ類(例えばメチルセロソルブ、エチルセロソルブ)、芳香族類(例えばトルエン、キシレン、クロルベンゼン)、ケトン類(例えばアセトン、メチルエチルケトン)、エステル系溶剤(例えば酢酸エチル、酢酸ブチルなど)、エーテル類(例えばテトラヒドロフラン、ジオキサン)、塩素系溶剤(例えばクロロホルム、トリクロルエチレン)、アミド系溶剤(例えばジメチルホルムアミド、Nーメチルピロリドン)、ジメチルスルホキシド等が挙げられる。

【0095】前記塗工には、従来から公知のグラビアロールによる面順次塗り別け塗布法、押し出し塗布法、ワイヤーバー塗布法、ロール塗布法等を採用することができる。

[0096]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明 するが、本発明の実施態様はこれらに限定されるもので はない。

【0097】 (実施例1)

[支持体の作成] 厚さ $0.24 \,\mathrm{mm}$ のアルミニウム板 (材質 1050、調質 H16) を 65%に保たれた 5% 水酸化ナトリウム水溶液に浸漬し、 1 分間脱脂処理を行なった後水洗した。この脱脂したアルミニウム板を、 25%に保たれた 10%塩酸水溶液中に 1 分間浸漬して中和した後水洗した。次いで、このアルミニウム板を 1.0 重量部の塩酸水溶液において、温度 25%、電流密度

100A/dm²の条件で交流電流により60秒間電解 粗面化を行なった後、60℃に保たれた5%水酸化ナト リウム水溶液中で10秒間のデスマット処理を行なっ た。デスマット処理を行なった粗面化アルミニウム板を 40%燐酸溶液中で、温度30℃、電流密度4A/dm ²の条件で6分間陽極酸化処理を行ない、更に硅酸ソー ダで封孔処理を行なって支持体を作成した。

【0098】 [感光層の作成] 上記支持体上に下記処方の感光層を支持体に対して付き量約1.3g/m²となるように塗布した。感光層は塗布後に、80℃で3分間乾燥した。

[0099]

色素 (D-5)

ラジカル発生剤(BTTB)

0.20重量部

0.40重量部

M450 (ペンタエリスリトールテトラアクリレート

: 東亜合成(株)社製)

4. 47重量部

フッ素系界面活性剤(メガファックF179:大日本インキ社製)

0.10重量部

重合禁止剤 (スミライザーGS:住友化学社製)

0.02重量部

メチルエチルケトン

45重量部

プロピレングリコールモノメチルエーテル 銅フタロシアニン系顔料(0.3μm) 45重量部 0.58重量部

[保護層処方]上記感光層上に、下記、処方の保護層を 支持体に対して付き量約1.3g/m²となるように塗 布した。感光層は塗布後に、80℃で3分間乾燥した。 【0100】

ポリビニルアルコール (ゴーセノールGL-05)

9.9重量部

フッ素系界面活性剤 (メガファックF120:大日本インキ社製)

0. 1 重量部

90.0重量部

水

CGI784を用いた。

(実施例 $2\sim 20$) 実施例 1 の色素とラジカル開始剤を表 1 のように代えて実施例 $2\sim 20$ を作成した。尚、チタノセン化合物 T i -1 は日本チバガイギー(株)社製

【0101】(実施例21)実施例1の感光層を下記の 処方に代えた以外は同様に作成した

色素 (D-22)

0.20重量部

ラジカル発生剤(BTTB) M450 (ペンタエリスリトールテトラアクリレート 0.40重量部

: 東亜合成(株)社製)

.

:泉里古成(休)工表)

4. 47重量部

重合促進剤1(鉄アレーン錯体)

0.45重量部

重合促進剤2(メルカプトベンゾオキサゾール)

0.083重量部

フッ素系界面活性剤 (メガファックF179:大日本インキ社製)

0.10重量部

重合禁止剤 (スミライザーGS:住友化学社製)

0.02重量部

メチルエチルケトン

45重量部

プロピレングリコールモノメチルエーテル

4 5 重量部

銅フタロシアニン系顔料 (0.3μm)

0.58重量部

(実施例22~30) 同様に実施例21の色素、ラジカル発生剤、重合促進剤1、重合促進剤2を下表のように変更し、感光性樹脂組成物を作成した。チタノセン化合物Ti-1は日本チバガイギー(株)社製CGI784を用いた。

[0102]

【化13】

【0103】 【表1】

比較<u>化合物-2</u>

文化合物	<u> 切一乙</u>						
実施例	色素	ラジカル開始前	添加 量化	重合促進剤 1	海加 春%	重合促進剤 2	添加 量%
1	D-5	BTTB	4.0	E II KASAN			===
2	D-2	ВТТВ	4.0		_		_
3		BTTB	4.0				=
4		ВТТВ	4.0				_
5		ВТТВ	4.0		_		_
6	D-21	BTTB	4.0				=
7	D-22	BTTB	4.0				\equiv
8	D-5	Ti-1	4.0	_		_	
9	D-2	Ti-1	4.0			_	_
10	D-10	Ti-1	4.0				=
11	D-15	Ti-1	4.0		_		_
12	D-20	TI-1	4.0		_		
13	0-21	Ti-1	4.0			_	=
14	D-24	Ti-1	4.0		_		_
15	D-22	シ フェニルヨート ニウム塩	4.0		_	_	_
		1,3,5-トリストリク					
16	D-22	ロロ-S-トリアジン	4.0	_	_	-	- 1
17	D-22	t' 2439' y' -b	4.0			_	_
18	D-22	鉄7レーン錯体	4.0	_	_		_
19	D-2	Ti-1	4.0				
20	D-22	ホウ素塩化合物	4.0		-		_
21	D-22	вттв	4.0	鉄アレーン錯体	4.0	1,3,5-ペンタメチ ルアニリン	4.0
22	D-22	вттв	4.0	鉄アレーン錯体	_	メルカプトベンゾ オキサゾール	4.0
23	D-15	BTTB	4.0	鉄アレーン錯体	4.0	メルカプトペンゾ オキサゾール	4.0
24	D-22	Ti-1	4.0	鉄アレーン錯体	4.0	1,3,5-ペンタメチ ルアニリン	4.0
25	D-22	Ti-1	4.0	鉄アレーン錯体	4.0	メルカプトベンソ オキサゾール	4.0
26	D-15	Ti-1	4.0	鉄アレーン錯体	4.0	メルカプトベンソ オキサゾール	4.0
27	比較化 合物-2	вттв	4.0		<u>L</u>		_
28	比較化 合物-2		4.0	鉄アレーン錯体	4.0	1,3,5-ペンタメチ ルアニリン	4.0
29	比較化 合物-2	вттв	4.0			<u> </u>	_
30	比較化 合物-2	вттв	4.0	鉄アレーン錯体	4.0	1,3,5-ベンタメチ ルアニリン	4.0

【0104】表1中の鉄アレーン錯体は化10中の化合物(4)である。

【0105】このようにして作成した光重合型平版印刷版について、明室プリンター[大日本スクリーン(株)

社製 P-627-HA]を用い露光後、下記現像液を用いて30℃、30秒浸漬して未露光部の感光層を溶出したものを、水洗後乾燥して画像を作成し確認した。

[0106]

現像液処方

A珪酸カリウム(日本化学工業社製: 400重量部 $S i O_2 = 26\%$, $K_2 O = 13.5\%$) 195重量部 水酸化カリウム (50%水溶液) N-フェニルエタノールアミン 6重量部 50重量部 プロピレングリコール 150重量部 p – t – ブチル安息香酸 300重量部 亜硫酸カリウム ノニオン活性剤(エマルゲン147:花王社製) 5 重量部 100重量部 グルコン酸(50%水溶液) 25重量部 トリエタノールアミン 11500重量部

【0107】得られた各平版印刷版について以下の特性を評価した。結果を表2に示す。

pH=12.5に調整する。

【0108】《汚れの評価》UgraプレートコントロールウェッジPCW82(ミカ電子社製)による画像を、連続諧調ウェッジが3段となるような露光量で作成し、印刷機(ハイデルGTO)で、コート紙、印刷インキ(東洋インキ製造社製:ハイプラスM紅)及び湿し水(コニカ(株)社製:SEU-3の2.5%水溶液)を用いて印刷を行い、印刷初期段階(1000枚程の時点)での印刷物の非画像部の汚れを目視で4段階評価した。

[0109]

◎:全く汚れがなかった○:僅かに汚れがあった

△:×ほど全面に汚れは出ていないが実用上問題になる

程度の汚れが出た×:全面に汚れが出た

実用上使用できるのは◎と○である。

【0110】《感度評価》作成した平版印刷用原版を、

保護層側が光源側になるようにドラムに巻き付け、ドラムを回転しながら100 mW高調波 YAGレーザ(DPY315 M, LD励起SHG, YAGレーザー(532 nm):ADLAS社製)を用いて露光した。レーザー光強度はガウス分布していると考え、ドラムの回転数を一定にしてレーザー光強度の $1/e^2$ に相当する所の線幅と形成された画像の線幅が等しい所の光強度(μ W/c m^2)を求め、照射時間との積からエネルギー値を求めた。又、488 n mはアルゴンレーザーを用いて露光した。

【0111】《保存性評価》露光・現像処理する前の各 試料で作成した版を、55℃/20%RHでの強制劣化 を3日間行った後、上記と同様に露光・現像を行い、非 画線部の抜け性により保存後の現像性の評価とした。 又、上記と同様に印刷評価も行った。

【0112】得られた結果を以下に示す。

[0113]

【表2】

	488nm	488nm	532nm	532nm	Γ	
実施例	感度 mJ	保存性	感度mJ	保存性	汚れ	
1	0.35	0.39	0.35	0.36	0	本発明
2	0.24	0.25	0.3	0.31	0	本発明
3	0.36	0.38	0.38	0.39	0	本発明
4	0.29	0.3	0.12	0.13	0	本発明
5	0.34	0.35	0.35	0.38	0	本発明
6	0.15	0.15	0.25	0.26	0	本発明
7	0.09	0.09	0.1	0.12	0	本発明
8	0.33	0.35	0.34	0.35	0	本発明
9	0.18	0.2	0.25	0.25	0	本発明
10	0.3	0.32	0.35	0.36	0	本発明
11	0.22	0.25	0.08	0.08	0	本発明
12	0.3	0.35	0.3	0.33	0	本発明
13	0.15	0.16	0.25	0.26	0	本発明
14	0.07	0.07	0.1	0.12	0	本発明
15	0.11	0.12	0.11	0.13	0	本発明
16	0.12	0.12	0.1	0.12	0	本発明
17	0.13	0.13	0.12	0.12	0	本発明
18	0.14	0.14	0.15	0.18	0	本発明
19	0.04	0.05	0.14	0.15	0	本発明
20	0.12	0.12	0.14	0.24	0	本発明
21	80.0	0.08	0.07	0.07	0	本発明
22	0.09	0.09	0.07	0.07	0	本発明
23	0.19	0.2	0.1	0.1	0	本発明
24	0.03	0.04	0.1	0.1	0	本発明
25	0.03	0.03	0.1	0.1	0	本発明
26	0.05	0.06	0.09	0.1	0	本発明
27	0.2	1.2	0.4	2.1	Δ	比較例
28	0.25	1.4	0.35	2	Δ	比較例
29	0.18	1.4	0.35	1.5	Δ	比較例
30	0.15	0.9	0.33	1.2	Δ	比較例

[0114]

【発明の効果】実施例で実証した如く、本発明により、 488nm又は532nm付近の光で書込ができ、解像 度、感度の良好な画像を形成できる光開始剤、ラジカル 発生方法、光重合性組成物を提供することができ、これ を用いて高感度かつ保存安定性に優れた平版印刷版作成 用感光材料が作製でき、かつ本発明による平版印刷版の 作成方法により高感度で保存性に優れた印刷物を得るこ とができる。

フロントページの続き

(51) Int.C1.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 3 F 7/20

505

G O 3 F 7/20

5 0 5